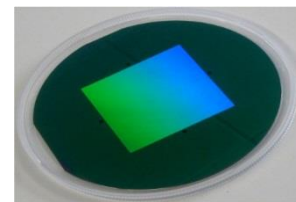


Eulitha的光子纳米模板由Eulitha开发的开创性PHABLE™光刻机制作的，纳米模板兼具高品质和价格优势。标准纳米模板提供大面积的纳米周期图案（线栅、四方排布、六方排布）。通过优化硅基和石英基的刻蚀工艺，可得到适合压印的轻微正斜率结构。

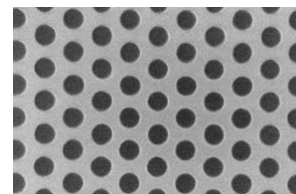


六方排布孔阵列 – 600nm 周期

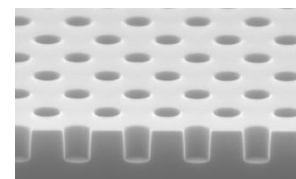
- LED 光萃取层
- 晶体生长模板
- 纳米压印开发
- 传感器阵列
- 衍射光栅
- 激光布拉格光栅
- 纳米颗粒制造

六方排布孔阵列

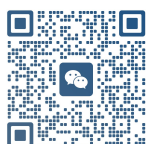
产品型号	周期	面积	最大刻蚀深度 (硅/石英)
P200h_h_100d	200nm	94mm dia.	120nm / 100nm
P350h_h_100d	350nm	94mm dia.	200nm / 100nm
P450h_h_50d	450nm	50mm dia.	350nm / 150nm
P500h_h_100d	500nm	94mm dia.	500nm / 300nm
P600h_h_100d	600nm	94mm dia.	450nm / 200nm
P750h_h_51w51	750nm	51x51mm ²	450nm / 200nm
P780h_h_50d	780nm	50mm dia.	450nm / 200nm
P870h_h_100d	870nm	94mm dia.	550nm / 250nm
P1000h_h_100d	1000nm	94mm dia.	600nm / 300nm
P1500h_h_51w51	1500nm	51x51mm ²	600nm / 300nm
P1700h_h_100	1700nm	94mm dia.	800nm / 400nm
P2000h_h_100d	2000nm	94mm dia.	800nm / 400nm
P3000h_h_100d	3000nm	94mm dia.	1000nm / 400nm
P3450h_h_100d	3450nm	94mm dia.	1200nm / 500nm
P5200h_h_100d	5200nm	94mm dia.	1200nm / 500nm



六方排布阵列 – 350nm 周期

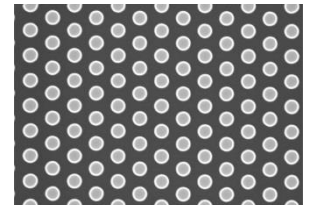


六方排布阵列 – 600nm 周期

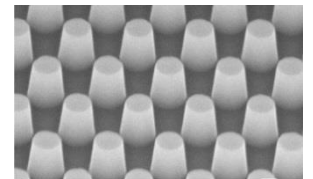


六方排布柱阵列

产品型号	周期	面积	最大刻蚀深度 (硅/石英)
P200h_p_100d	200nm	94mm dia.	90nm / 80nm
P450h_p_50d	450nm	50mm dia.	350nm / 150nm
P500h_p_100d	500nm	94mm dia.	400nm / 200nm
P600h_p_100d	600nm	94mm dia.	450nm / 200nm
P750h_p_51w51	750nm	51x51mm ²	450nm / 200nm
P780h_p_50d	780nm	50mm dia.	450nm / 200nm
P870h_p_100d	870nm	94mm dia.	550nm / 250nm
P1000h_p_100d	1000nm	94mm dia.	600nm / 300nm
P1500h_p_51w51	1500nm	51x51mm ²	600nm / 300nm
P1700h_p_100d	1700nm	94mm dia.	800nm / 400nm
P2000h_p_100d	2000nm	94mm dia.	800nm / 400nm
P3000h_p_100d	3000nm	94mm dia.	1000nm / 400nm
P3450h_p_100d	3450nm	94mm dia.	1200nm / 500nm
P5200h_p_100d	5200nm	94mm dia.	1200nm / 500nm



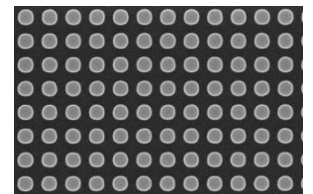
六方排布 - 600nm 周期



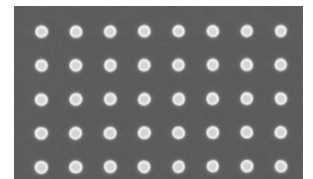
六方排布 - 600nm 周期

四方排布柱阵列

产品型号	周期	面积	最大刻蚀深度 (硅/石英)
P125s_p_90d	125nm	90mm dia.	90nm / 60nm
P140s_p_80d	140nm	80mm dia.	75nm / 80nm
P150s_p_90d	150nm	90mm dia.	75nm / 80nm
P190s_p_100d	190nm	94mm dia.	200nm / 90nm
P200s_p_90d	200nm	90mm dia.	200nm / 90nm
P250s_p_90d	250nm	94mm dia.	200nm / 100nm
P280s_p_80d	280nm	80mm dia.	200nm / 100nm
P300s_p_100d	300nm	94mm dia.	200nm / 100nm
P380s_p_100d	380nm	94mm dia.	400nm / 300nm
P400s_p_100d	400nm	94mm dia.	300nm / 100nm
P470s_p_100d	470nm	94mm dia.	500nm / 400nm
P500s_p_100d	500nm	94mm dia.	400nm / 150nm
P560s_p_80d	560nm	80mm dia.	400nm / 150nm
P600s_p_100d	600nm	94mm dia.	500nm / 250nm
P760s_p_100d	760nm	94mm dia.	700nm / 600nm
P800s_p_100d	800nm	94mm dia.	500nm / 300nm



四方排布 - 500nm 周期

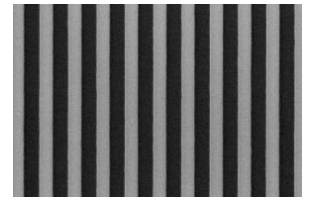


四方排布 - 300nm 周期

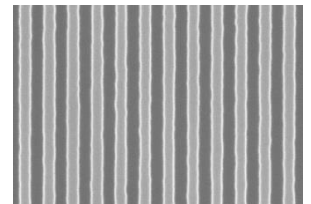


线条光栅

产品型号	周期	面积	最大刻蚀深度 (硅/石英)
P125L_80d	125nm	80mm dia.	100nm / 80nm
P140L_80d	140nm	80mm dia.	100nm / 80nm
P150L_90d	150nm	90mm dia.	100nm / 80nm
P200L_90d	200nm	90mm dia.	150nm / 120nm
P250L_100d	250nm	94mm dia.	200nm / 100nm
P280L_80d	280nm	80mm dia.	200nm / 100nm
P300L_100d	300nm	94mm dia.	300nm / 100nm
P380L_100d	380nm	94mm dia.	400nm / 300nm
P400L_100d	400nm	94mm dia.	300nm / 150nm
P450L_100d	450 nm	94mm dia.	300nm / 150nm
P470L_100d	470nm	94mm dia.	500nm / 400nm
P500L_100d	500nm	94mm dia.	400nm / 200nm
P560L_80d	560nm	80mm dia.	400nm / 200nm
P600L_100d	600nm	94mm dia.	500nm / 250nm
P760L_100d	760nm	94mm dia.	700nm / 600nm
P800L_100d	800nm	94mm dia.	600nm / 300nm
P1000L_100d	1000nm	94mm dia.	800nm / 400nm
P1300L_75w55	1300nm	75x55mm ²	1000nm/ 500nm



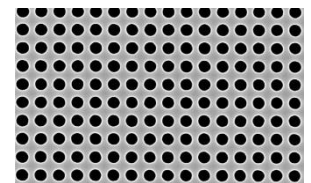
线条光栅 – 600nm 周期



线条光栅 – 150nm 周期

四方排布孔阵列

产品型号	周期	面积	最大刻蚀深度 (硅/石英)
P125s_h_90d	125nm	90mm dia.	150nm / 100nm
P140s_h_80d	140nm	80mm dia.	150nm / 100nm
P150s_h_90d	150nm	90mm dia.	150nm / 100nm
P190s_h_100d	190nm	94mm dia.	180nm / 140nm
P200s_h_90d	200nm	90mm dia.	200nm / 150nm
P235s_h_100d	235nm	94mm dia.	200nm / 150nm
P300s_h_90d	300nm	90mm dia.	200nm / 150nm
P350s_h_100d	350nm	94mm dia.	300nm / 150nm
P375s_h_100d	375nm	94mm dia.	200nm / 100nm
P450s_h_100d	450nm	94mm dia.	300nm / 150nm

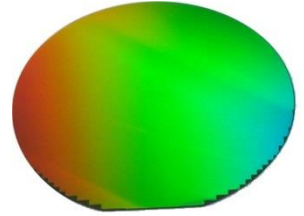


四方排布孔阵列 – 350nm 周期



Notes

- 标准模板可以在4"硅或石英基片制作
- 更小或者其它尺寸的衬底，可根据需求切割
- 标准的特征尺寸接近图形的半周期附近
- 如有其它占空比需求，例如更小的孔或柱直径，请具体咨询
- 标准模板的结构高度可根据客户要求定制
- 超过标称最大刻蚀深度的需求，请具体咨询
- 在大多数情况下，以上标准图案，可以在客户的基片上制作光刻胶结构，例如：在GaN或蓝宝石衬底上制作光刻胶结构
- 针对纳米压印应用，可以根据需求，对标准模板进行抗粘处理



六方排布孔阵列 4" 基片 - 600nm 周期

